ポリマー材料による液晶レーザーデバイスの 発振特性改善

荒岡 史人·竹添 秀男

Polymeric Liquid Crystal Lasers

Fumito ARAOKA and Hideo TAKEZOE

In this article, we will demonstrate our recent approaches to the device design of liquid crystal photonic lasers by utilizing polymeric materials to stabilize their structures, aiming at widely tunable, stable and highly efficient lasing.

Key words: liquid crystal, photonic crystal, laser

現在,「液晶」という言葉がそのまま「液晶ディスプレ イ」のことを指し示すほど,表示素子材料としての液晶は 技術的に成熟し社会に浸透している.しかし,一口に液晶 材料といっても,その構造・物理的性質は分子の自己組織 化の形態により多様であり,その応用は表示素子のみにと どまらない.これまでに,発光,光導電性,非線形光学, 近接場光学,光計測,光記録,光通信,光変調,ホログラ フィーといったおもに光技術分野において,広範にわたり 研究がなされている.これらの光技術のほとんどにおい て,液晶材料の魅力とは,構造異方性と流動性とを兼ね備 えることによる光学物性の可制御性にある.

上で述べた通り,液晶分子の自己組織化形態は幾種類に も及ぶが,その中で,キラルな液晶材料の形成するコレス テリック相,キラルスメクチックC相,TGB相などの液 晶相では,分子(あるいは分子集合のブロック)がらせん 状に配列することが知られている(図1).これらのらせ んが光学波長程度の周期をもつときには,らせんの巻き方 向に対応した円偏光のみが全反射される波長領域(選択反 射帯)が現れる.その本質は,誘電異方構造が繰り返され ることによるブラッグ反射であり,選択反射帯はいわゆる フォトニックバンド構造のストップバンド(禁制帯)に対 応している.したがって,このような媒質は一次元フォト ニック結晶として振る舞う.通常,フォトニック結晶を作 製するためには、光学波長オーダー(数百 nm)での構造 制御が必要となるが、これら液晶のらせん構造は自発的に 形成されることに加え、そのらせん周期は添加物や熱・電 場などの入力により容易に制御でき、加工性の面から大き な利点をもっている。しかしその一方で、レーザーを主体 とした光学デバイスとしての応用を考えた場合、光学的・ 熱的な構造安定性は必須である。したがって、上記のよう な制御性のよさが問題点となることもまた事実である。

液晶フォトニック材料でも、第一に考えられるデバイス 応用はレーザーである。1997年にKoppらが、コレステ リック液晶 (CLC)のストップバンド端において光子の状 態密度 (DOS)が増大しレーザー発振に至ることを報告し て以来¹⁾、多くの研究者が液晶フォトニック材料における レーザー発振を研究することとなった(文献2)が詳しい ので参考にされたい).

これまでにわれわれの研究室が発表してきた液晶フォト ニックデバイスは多岐にわたる³⁾.レーザー発振素子に関 しては、主としてデバイスの発光効率の向上および励起エ ネルギーの低下、発振波長のチューニング可能領域の拡大 などのデバイスパフォーマンスの向上を目的としており、 具体的には、液晶と相溶性の高い高分子色素の導入、金属 鏡と組み合わせたハイブリッド素子の作製、ネマチック液 晶とのハイブリッド構造や複層構造による欠陥モードの導

東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻(〒152-8552 目黒区大岡山 2-12-1-S8-42) E-mail: araoka.f.aa@m.titech.ac.jp



図1 液晶の自発形成する一次元フォトニック構造.

入などのアプローチを行っている. レーザー素子以外で は、赤緑青に対応した波長を反射させる白色リフレクター や、片側からしか光が透過しない光ダイオードなど、これ までに例のないユニークなフォトニックデバイスのほか, 有機エレクトロルミネセンス素子 (OLED) と組み合わせ た円偏光発光 OLED の創製にも成功している。これら研 究の多くで,素子作製において重要な役割を担うのが液晶 性ポリエステル材料や光重合性材料などの高分子材料であ る。これら高分子材料を採用することで、素子作製の過程 で液晶フォトニック構造を室温において固定化することが でき、特に複層構造や変調構造の固定化などで優位性を発 揮する. さらには,構造固定化により,上で述べた光学的 な不安定性を改善するものでもある。本稿では, 高分子材 料を用いた固定化液晶フォトニックレーザー素子の中か ら,1.空間変調構造チューナブルレーザー素子,2.ポリ マーとの複合層構造導入による低閾値レーザー発振素子に ついて紹介する.

高分子液晶材料を用いたフォトニックレーザー発 振素子

液晶を利用したフォトニックデバイスとして最も基本的 なものは、ミラーレス・チューナブルレーザー発振素子で ある。例えば、コレステリック液晶に、選択反射帯に対応 した波長に発光域をもつレーザー色素を添加し光励起させ ると、発光の閉じこめが起こる。励起光強度を増大させて



図2 光重台性コレステリック液晶. (a) ジアクリレートメ ソゲン, (b) モノアクリレートメソゲン.

ゆくと、ある閾値をもってスペクトルの狭線化が起こり、 レーザー発振へと至る.この場合、液晶媒質はフォトニッ クバンドによる分布帰還型キャビティーとレーザー活性媒 質の両方を備えた共振器と考えられ、その発振周波数はス トップバンド端に対応している.温度変化や電場印加など によりらせん周期を変化させると、それに伴ってストップ バンドが移動し、発振線の波長が連続的にシフトする、つ まりチューナブルレーザー発振素子となる.液晶フォトニ ックレーザー素子を応用した具体的なデバイスとして想定 されるのは、例えば光通信やレーザーディスプレイなどに 用いられる光源である.これらへ適用することを想定した 場合、広く安定な発振波長チューナビリティーと連続発振 (CW発振)が望まれている.しかし、これまでの研究で は、これらに関して満足のいく性能が達成されているとは いいがたい.

1.1 空間変調固定型チューナブルレーザー発振素子4)

発振波長チューナビリティーに関しては, 一般的な液晶 材料では温度や電場などで動的に制御できる範囲は、せい ぜい数十 nm 程度に限られる。らせんピッチの空間変調構 造を導入することにより、およそ 300 nm にもわたる発振 帯域を得たという報告もあるものの,1. 変調構造はキラ ルドーパントの空間的な濃度勾配により形成されている が,時間とともに拡散してしまい最終的には変調が消失し てしまう、2. 広い発光帯域を得るため6種類もの色素が 必要である、3. 全可変域にわたり発振ができるわけでは なく,途中40nmほど発振できない帯域がある,など, チューナブル素子として完全でなかった5-7)。われわれは, このような空間変調構造を基本としながら、より安定な波 長チューナビリティーを実現するため構造を固定化させ た.また、使用する色素も2種類とすることで作製プロセ スを簡素化し、変調構造に合わせて拡散させた。結果とし て,短波長領域では色素の直接励起プロセスで,長波長領 域では色素から色素へのフェルスターエネルギー移動によ る間接励起プロセスで発光させることができ,固定化させ た変調構造の全域での発光を実現した。

38巻12号(2009)



図4 空間変調構造のテクスチャー(上)と重合直後の各部位の反射スペクトル(下).

フォトニック構造のホスト材として, 光重合性の高分子 CLC (03-008, メルク)を用いた。03-008 は重合性ジアクリ レートメソゲンと重合性モノアクリレートメソゲン (図2) の1:1混合物であり、少量のキラル剤が添加されている。 らせんの空間変調構造を形成させるため,低分子 CLC (ZLI-2293,メルク)を拡散させ空間的な濃度勾配を与え ることで、相対的にキラル剤の濃度勾配を発生させた。レ ーザー活性分子としては、クマリン153 (C153) と 4-(ジ シアノメチレン)-2-メチル-6-(4-ジメチルアミノスチリル) 4H-ピラン (DCM) の2種を用いた.素子形態は,2枚の ガラス板を向かい合わせに組みあわせた一般的なサンドウ ィッチ型液晶セルである。厚さ1mmのガラス基板のセ ル内側表面にはポリイミド液晶配向膜(AL1254, JSR)を スピンコートし, 平行ラビング処理を行った。ガラス基板 間の間隔は PET フィルムスペーサーを挟み込むことによ り, 16 µm に調整されている。液晶は、ガラスの合わせ



図5 重合1週間後(a),重合1か月後(b)の反射スペクトル.

目部分に接触させることで毛細管現象によりセル内部に導入されるが、ZLI-2293 および色素の濃度勾配を形成させるため、各成分の比が異なる2種類の混合物A(短らせんピッチ、03-008:ZLI-2293:C153:DCM=99.6:0:0.4:0)、B(長らせんピッチ、03-008:ZLI-2293:C153:DCM=66.7:32.8:0.4:0.1)を用意し、セル両端から導入し中央部で接触させ拡散させることでこれを得た(図3).適度に加熱し、低分子液晶および色素が拡散し濃度勾配が形成されたところで、室温で水銀灯の紫外光(365 nm、1 mW/cm²)を照射し光重合により硬化させたところ、自己保持可能なシート状の素子とすることができた.

まず,上記方法で作製した空間変調素子の構造評価を行った.図4に変調方向に沿った偏光顕微鏡観察像と光重合 直後の反射スペクトルを示す.素子のおよそ5mmにわ たってらせんの周期変調に起因する階調的な色の変化およ び,それに対応した選択反射バンドのシフトがみられ,変 調構造が形成されていることがわかる.さらに,図5には 光重合1週間後,1か月後の反射スペクトルを図に示す. 光重合直後のものと比較し,各反射スペクトルの形状や全 体的なシフト量には明確な変化がみられず,変調構造が保 持されていることが確認された.続いて,レーザー発振特



性の評価を行った。励起用光源として Nd: YAG レーザ -励起OPO (Surelite OPO, Continuum) を用い, C153 の吸収極大である 410 nm のパルス光 (パルス幅:約5 ns) を直径約100 µm に集光し、素子に照射した。このときの 素子の発光を小型マルチチャネル分光器 (USB4000, Ocean Optics) に入力し、スペクトルを測定した。素子の 励起位置を固定し,励起光強度を増加させてゆくと,ある 閾値をもって発光ピークが狭線化し,シングルモードのレ ーザー発振に至る.励起光の照射位置をずらしてゆくと, それぞれの位置で選択反射バンド端に対応したレーザー発 振がみられた.これを図6に示す.特筆すべきは,C153 の発光がない長波長域においても強い発振が得られている ことである.この帯域では、われわれの狙い通り、光励起 された C153 分子から DCM 分子へフェルスター機構を介 した分子間エネルギー移動が起こった結果, DCM 分子が 発光していることを示している。結果として、われわれの 空間変調構造素子では、可視光を広くカバーする 470 nm から 670 nm までの領域すべてで発振が可能であった。可 変帯域幅としては先の報告には及ばないものの、素子を固 定化することにより2か月にもわたって発振機能を維持さ せることができた。2種類の色素を拡散させる方式のた め,素子構造が簡便であり作製が容易である。また,付随 的にフレキシブルなシート状デバイスとすることができ た.現在は, OPOの410 nmのパルス光を光源としてい るが,チューナブルレーザーをチューナブルレーザーで励 起している矛盾がある。今後はより汎用性を高めるため に、355 nm (Nd: YAG THG) や400 nm (Ti: Sapphire SHG) などの、より一般的なレーザーラインでの励起が 可能な素子を検討する.

1.2 ポリマーとの複合層構造導入による低閾値化

今まで,液晶フォトニックレーザーにおいて CW 発振 が達成された例はない.強い励起光を連続的に照射し続け ることで、色素分子が破壊されてしまうためである.これ を解決するには、何らかの手段で発振閾値を下げること、 および分解されにくい色素の開発、効率よい熱拡散や循環 などにより熱ダメージを減らすことが必要である. 閾値を 抑えるための試みとしては、誘電体多層膜などで液晶層を 挟み込んだものや、らせん配列の位相ジャンプを利用した ものが報告されている²⁾。これらは基本的にはフォトニッ クストップバンド中に欠陥モードを導入する試みであり, 複合構造化により実現される.本研究では,このような複 合構造を発想点として, 複数のらせんを積み重ねる構造を 検討した.先に述べたとおり,CLCなどのらせん構造で は、らせんの向きに対応した円偏光のみがストップバンド の影響を受ける.このことから、閉じこめ効率を改善する ために、巻き方向の異なるらせんを積み重ねた分布帰還型 ミラー (DBR) を導入した素子構造を提案し, Berreman の4×4マトリクス法による理論計算と実験の両面から考 察を行った。

本研究では, 側鎖にキラル部位を含む主鎖型ポリエステ ルコレステリック液晶 (PCLC,新日本石油)を複層構造 作製に用いた。この材料はサーモトロピックであり、高温 の CLC 相でらせん構造を自発形成させた後、ガラス転移 点以下まで急冷することにより液晶相の構造を固定化させ ることができる. そのため, 室温における構造安定性が非 常に高いことが特長である。また、2種のエナンチオマー の混合比率および熱処理温度により、らせんの周期と巻き 方向を正確に制御することが可能である。そのほかにも, 低分子液晶材料にはない利便性として、デバイス作製プロ セスの簡便さが挙げられる。本研究で用いられた PCLC は,配向処理を施した基板上にスピンコートすることで, 高い配向性をもったフィルムを作成することができる。し たがって,その形態が通常の液晶セルに留まる必要がな く、複数の PCLC 膜を重ねる、あるいは、PCLC 膜を液 晶セルに導入し低分子液晶と組み合わせるなど, さまざま な複合構造を作製することができる.本研究では、後者の 液晶セルによる素子を作製した。

本研究では発光分子としてクマリン540(C540)を用い ており、その発光帯に合わせてストップバンドが500 nm 付近となるよう2種のPCLCを混合させた。これをクロ ロホルムに溶解させ、前項と同様の配向処理を施したガラ ス基板上にスピンコートした。複数のPCLCフィルムを 重ねる場合には、中低温のオーブン中で溶媒を蒸発させた うえで、保護層/配向膜としてポリビニルアルコール (PVA)をスピンコートした後にラビング処理を施し、 PCLCのスピンコートを繰り返した。このように作製し





た PCLC 膜がセル内側面となるように,前項同様サンド ウィッチ型液晶セルを作製した.レーザー活性層とし て C540 を 0.42 wt% ドープした低分子 CLC (左巻き, ZLI2293: MLC6247=73:27,メルク)を注入した.な お,低分子 CLC の反射帯中心も, PCLC の反射帯中心に 一致するよう 500 nm となっている.

はじめに、4×4マトリクス法によるシミュレーション の一例として、(a)単層構造:左,(b)3層構造:左左左, (c)5層構造:左右左右左に対する反射率とDOSを図7 に示す(ここでは各構造に付記した左右は各層のらせんの 巻き方向を示している).いずれも、左円偏光ストップバ ンドのエッジに近い位置でDOSの増大がみられ、この波 長においてレーザー発振する可能性を示している.しかし ながら、5層構造では左円偏光だけでなく右円偏光でも光 閉じこめが起こるため、DOSのピーク値はこれらの合計 で4500にも達し、単純比較では単層の場合の約50倍も高 く,より効率がよくレーザー発振をしやすい条件にあるこ とが示唆されている。このほかの3層,5層の構造に関し ても同様の計算を行った結果,上記(c)にあたる5層構 造:左右左右左が最もDOSが高く,発振しやすい条件で あると考えられた。

実際にこれらのセルを作製し、光励起レーザー発振を観察した.測定機器および手法は前項と同じである.図8 は、発光強度と発振線幅を励起エネルギーに対してプロットしたものである.いずれのセルでもレーザー発振が観測 できるものの、その閾値エネルギーにはっきりと差が認められる.この結果では、DOSのピーク値に反映されるとおり閾値エネルギーは(a)>(b)>(c)という関係にあり、 それぞれ260 nJ/pulse、118 nJ/pulse、86 nJ/pulseと求 められた.このことから、理論計算から予測されたとおり、明らかに複合構造に起因し閾値エネルギーの低減が達成されていることが確認された.しかしながら、それでも 連続励起に換算した場合には数十 W 程度の光強度に対応 しており、CW 発振のためには光に強い色素材料の開発, さらなるキャビティー構造の改善が必要である.

液晶フォトニックレーザーデバイスに関して,現在具体 的なデバイスとして求められている波長チューナビリティ ーと CW 発振に向け、おもに高分子 CLC 材料を用いた素 子デザインを考案し,実際に素子を作製し検討を行った. 前者に関しては、光重合性高分子 CLC を用いることで、 らせんピッチの空間変調構造を保持させ、長期間にわたっ て使用できる広帯域可変レーザーデバイスの作製に成功し た. 今後は、より広い可変帯域と、より一般的なレーザー ラインでの励起が可能な素子を目指す。後者では、サーモ トロピックな高分子 CLC を用い、巻き方向の異なるらせ んが積み重なった素子構造をデザインし, Berremen の 4×4マトリクス法を用いたシミュレーションと作製した デバイスの評価から,単純な単層構造に比べ,左右のらせ んが積み重なった複層構造の素子が優れた閾値特性をもつ ことを示した。それでも、現在得られている閾値はCW 励起による発振を実現するレベルには至っていない。しか し、より閾値の低い素子(キャビティー)構造のほか、ダ メージ閾値の高い発光色素の採用や励起条件の検討によっ て高効率な発振条件が実現できれば、必ずやCW 発振が 達成できると信じて研究を行っている. さらに多くの研究 者が参入し, さまざまな方面からのアプローチを期待し たい。

本研究において,素子作製,測定,シミュレーションの

ほとんどは東京工業大学大学院有機・高分子物質専攻,竹 添・石川研究室の真鍋貴信氏,園山幸司氏により行われま した.また本研究で用いた高分子液晶試料は,新日本石油 株式会社,およびメルク株式会社のご厚意により提供して いただきました.心よりの感謝を申し上げます.

文 献

- V. I. Kopp, B. Fan, H. K. M. Vithana and A. Z. Genack: "Low-threshold lasing at the edge of a photonic stop band in cholesteric liquid crystals," Opt. Lett., 23 (1998) 1707– 1709.
- M. Ozaki, Y. Matsuhisa, H. Yoshida, R. Ozaki and A. Fujii: "Photonic crystals based on chiral liquid crystal," Phys. Status Solidi A, 204 (2009) 3777-3789.
- 3) H. Takezoe, N. Y. Ha, M. H. Song, S. M. Jeong and B. Park: "Tuning laser light from liquid crystal lasers," *Liquid Crystal Microlasers* (Transworld Research Network, Kerala, India, 2009) Chap. 4.
- 4) T. Manabe, K. Sonoyama, Y. Takanishi, K. Ishikawa and H. Takezoe: "Toward practical application of cholesteric liquid crystals to tunable lasers," J. Mater. Chem., 18 (2008) 3040–3043.
- 5) A. Chanishvili, G. Chilaya, G. Petriashvili, R. Barberi, R. Bartolino, G. Cipparrone, A. Mazzulla and L. Oriol: "Lasing in dye-doped liquid crystals: Two new strategies of tuning," Adv. Mater., 16 (2004) 791-794.
- 6) A. Chanishvili, G. Chilaya, G. Petriashvili, R. Barberi, R. Bartolino, G. Cipparrone, A. Mazzulla and R. Gimenez, L. Oriol and M. Pinol: "Widely tunable ultraviolet-visible liquid crystal laser," Appl. Phys. Lett., 86 (2005) 051107.
- K. Sonoyama, Y. Takanishi, K. Ishikawa and H. Takezoe: "Position-sensitive cholesteric liquid crystal dye laser covering a full visible range," Jpn. J. Appl. Phys., 36 (2007) L874-L876.

(2009年7月1日受理)